04;07 Поднормальный тлеющий разряд на смеси Xe/Cl₂ в узкой разрядной трубке

© А.К. Шуаибов, А.И. Дащенко, И.В. Шевера

Ужгородский государственный университет, 88000 Ужгород, Украина

(Поступило в Редакцию 13 октября 2000 г.)

Приводятся результаты исследования электрических и оптических характеристик поднормального тлеющего разряда в короткой ($L = 10\,{\rm cm}$) разрядной трубке с внутренним диаметром 5 mm. Изучались вольт-амперные характеристики и энерговклад в разряд, спектральные характеристики плазмы в области 130–350 nm, яркости излучения полос с $\lambda = 236$ nm XeCl(D-X), 308 nm XeCl(B-X) и суммарной яркости излучения в области 180-340 nm в зависимости от величины давления и парциального состава смеси Xe/Cl₂. Показано, что наблюдаются две стадии тлеющего разряда: слаботочная (при разрядных токах $I_{ch} \leq 2\,\mathrm{mA}$) и сильноточная при $I_{ch} > 2\,\mathrm{mA}$, переход между которыми осуществляется в виде скачка. С увеличением содержания хлора в смеси возрастает падение напряжения на электродах трубки и наблюдается рост энерговклада в плазму. При пониженном давлении смеси Xe/Cl₂ (P < 0.7 kPa) в катодной области разряда наблюдалось формирование стоящих страт. Объем разряда, занятый стратами, возрастал с уменьшением разрядного тока. Исследуемый продольный разряд является мощным источником стационарного широкополосного излучения в области 180-340 nm, формирующегося в результате перекрытия полос излучения XeCl(D, B-X) и Cl^{*} с кантами при $\lambda = 236, 308$ и 258 nm. Яркость излучения полосы $\lambda = 236\,$ nm не превышала 20% от суммарной яркости ультрафиолетового (УФ) излучения. Для получения максимальной мощности УФ излучения оптимальное содержание хлора в смеси находится в диапазоне 250-320 Pa, а давление смеси равно 2 kPa. Максимальная мощность УФ излучения достигала 3 W при коэффициенте полезного действия 8%.

Введение

Продольный тлеющий разряд низкого давления на смесях тяжелых инертных газов (Ar, Kr, Xe) с молекулами хлора начал систематически изучаться более двадцати лет назад [1,2], что было обусловлено широким применением плазмы инертных газов с малыми добавками галогенсодержащих молекул в плазмохимии [3,4], квантовой электронике и других областях науки и техники. Первые исследования таких разрядов проводились в смесях Ar/Cl₂ [1] и Kr/Cl₂ [2] при давлении $P \le 130$ Ра в разрядных трубках диаметром 14–30 mm, длиной L = 50 сm и были в основном направлены на изучение функций распределения электронов по энергиям и электрических характеристик положительного столба.

Впервые продольный тлеющий разряд низкого давления на смесях Xe/Cl₂ и Kr/Cl₂ как эффективный стационарный излучатель в УФ области длин волн был предложен и оптимизирован в работах [5-7]. Разряд зажигался в кварцевых разрядных трубках длиной $L = 17 - 28 \, \mathrm{cm}$ с внутренними диаметрами 1.2-3.0 ст. Для разрядных токов $I_{ch} = 20-30 \,\mathrm{mA}$ в давлений $P = 0.6-4 \,\mathrm{kPa}$ мощность излучения эксимерной лампы достигала 10-20 W при КПД равном 12-23%. Исследование распределений концентрации молекул XeCl* и KrCl* по длине и диаметру разрядной трубки показало, что они являются неоднородными: наибольшее количество эксимерных молекул образуется в области анода и центральной части разрядной трубки [6]. Максимальный КПД УФ излучения достигался в данных экспериментах при сравнительно малых разрядных токах ($I_{ch} \leq 10\,\mathrm{mA}$), когда на электродах разрядной трубки наблюдался наибольший спад напряжения. Согласно классификации стадий продольного разряда постоянного тока, такая его высоковольтная стадия наблюдается при переходе от темного таунсендовского к нормальному тлеющему разряду и незывается поднормальным тлеющим разрядом (ПТР) [8]. ПТР в коаксиальной разрядной трубке длиной 40 ст успешно использовался для создания эксимерной лампы с КПД до 30% и мощностью излучения 8 W.

В настоящей работе продолжается публикация результатов наших исследований эксимерных излучателей пониженного давления ($P \le 30$ kPa) с накачкой электрическим разрядом, которые работают на смесях Ar, Kr и Xe с молекулами Cl₂ [9–14]. Основная особенность проведенных исследований связана с переходом в стационарный режим накачки и дальнейшем уменьшении давления рабочих смесей. В данной работе приводятся результаты исследования электрических, спектральных и энергетических характеристик ПТР низкого давления на смесях Xe/Cl₂, получаемого в короткой разрядной трубке малого диаметра.

Методика, техника и условия эксперимента

Тлеющий разряд зажигался в тонкостенной карцевой трубке с внутренним диаметром 5 mm и межэлектродным расстоянием 100 mm. Катод и анод разрядной трубки изготовлены из никеля, имели цилиндрическую

форму и одинаковые размеры. Внешний диаметр электродов составлял 5 mm, а их длина — 10 mm. Электроды устанавливались внутри кварцевой трубки в ее открытых концевых частях. Трубка размещалась в вакуумной камере с окном из CaF2 и тремя кварцевыми окнами диаметром 5 ст. Объем камеры составлял 101 и служил в качестве буферного для исследуемого тлеющего разряда. Камера через окно из CaF2 была пристыкована к полиметровому вакуумному монохроматору, изготовленному по схеме Сейя-Намиока и снабженному дифракционной решеткой на 1200 lines/mm. Центр разрядной трубки устанавливался, так что он находился на одном уровне с центрами входной и выходной щелей монохроматора. Приемником излучения служил фотоумножитель с LiF-окном (ФЭУ-142). Монохроматор и отсек с фотоумножителем откачивались до остаточного давления 10⁻³-10⁻⁴ Ра. Рабочий диапазон данного спектрофотометра составлял 130-350 nm. Относительная калибровка системы монохроматор + ФЭУ-142 проводилась в диапазоне $\Delta \lambda = 165-350 \,\mathrm{nm}$ по континууму молекул водорода. Система регистрации сигнала с фотопримника была аналогичной, описанной нами в работах [10-14]. ПТР зажигался при помощи высоковольтного выпрямителя $(U \le 30 \,\text{kV}; I_{ch} \le 100 \,\text{mA})$, напряжение с выхода которого подавалось на анод разрядной трубки через балластное сопротивление ($r_b = 400-700 \, \mathrm{k}\Omega$). Диапазон рабочих токов в эксперименте составлял $I_{ch} = 0.5 - 30.0 \,\mathrm{mA}$. Измерение абсолютной мощности излучения ПТР проводилось по методике работы [9] с использованием измерителя "Кварц-01". При этом между головкой измерителя "Кварц-01" и диафрагмой на поверхности разрядной трубки устанавливался светофильтр с полосой пропускания $\Delta \lambda = 200-400 \,\mathrm{nm}$ и учитывалась относительная спектральная чувствительность измерительной головки.

Электрические и оптические характеристики

ПТР существовал в форме слаботочной и сильноточной стадий, переход между которыми происходит скачком при $I_{ch} = 0.5$ -1.5 mA, что проявлялось на некоторых вольт-амперных характеристиках (рис. 1) в виде максимума U_{ch} при малых разрядных токах. В дальнейшем скорость спада U_{ch} замедлялась, что соответствовало выходу напряжения на плато и переходу в режим нормального тлеющего разряда. При $I_{ch} \geq 10 \, \mathrm{mA}$ наши ВАХ коррелировались с результатами работы [15] для трубки диаметром 9 mm, $L = 23 \, \text{сm}$ и $I_{ch} = 10-80 \, \text{mA}$. Форма ВАХ исследуемого ПТР в области малых токов была также подобной к ВАХ поднормального разряда в коаксиальной трубке [9]. С увеличением давления и содержания хлора в смеси наблюдался рост величины U_{ch} и энерговклада в разряд (рис. 2). Уменьшение давления смеси Xe/Cl₂ до 0.5-0.7 kPa приводило к формированию стоячих страт в катодной части разрядной трубки. С уменьшением величины тока от 10 до 3 mA страты равномерно заполняли всю длину положительного столба.



Рис. 1. Вольт-амперные характеристики ПТР на смесях Xe/Cl₂: *P*_{Xe}/*P*_{Cl₂} = 0.60/0.08 (*1*), 2.00/0.04 (*2*), 2.00/0.16 (*3*), 2.00/0.40 (*4*), 2.00/0.56 kPa (*5*).



Рис. 2. Зависимость мощности, вкладываемой в ПТР на смесях Xe/Cl_2 от содержания молекул хлора при $P_{Xe} = 2.0$ kPa и $I_{ch} = 3$ (1), 10 mA (2).



Рис. 3. Спектр излучения плазмы ПТР на смеси Xe/Cl₂.

Режим стратифицированного ПТР представляет интерес для разработки специальных источников УФ излучения с регулярным и управляемым распределением яркости



Puc. 4. Зависимость яркости излучения полос XeCl(D, B-X) и суммарной яркости плазмы ПTP в области $\Delta \lambda = 180-340$ nm от парциального давления ксенона при $P_{\text{Cl}_2} = 80$ Pa (a) и парциального давления хлора при $P_{\text{Xe}} = 2.0$ kPa (b): 236 nm (1), 308 nm (2) и $\Delta \lambda = 180-340$ nm (3); $I_{ch} = 8$ mA.

по рабочей поверхности излучателя. Такие излучатели представляют интерес для нанесения регулярных геометрических фигур на поверхность фоточувствительных материалов и изготовления специальных фотошаблонов.

В спектрах излучения ПТР на смеси Xe/Cl₂ (рис. 3) обнаружены сильно уширенные полосы с кантами при $\lambda = 236 \,\mathrm{nm} \,\mathrm{XeCl}(D-X), \,308 \,\mathrm{nm} \,\mathrm{XeCl}(D-X)$ и полоса $\lambda = 258 \,\mathrm{nm} \,\mathrm{Cl}_2 \,(D' - A')$. Из-за уширения и сильного перекрытия данных полос исследуемый излучатель можно рассматривать в качестве широкополосного с шириной полосы $\Delta \lambda = 340 - 180$ nm. Весь спектр излучения был разделен на две полосы: XeCl(B-X) (совместно с полосой $\lambda = 258 \,\mathrm{nm} \,\mathrm{Cl}_2^*$) и XeCl(D-X), так что при их сшивке получался исходный спектр, зарегистрированный в настоящем эксперименте. Для каждой смеси по спектру излучения ПТР в области $\Delta \lambda = 180-340 \, \text{nm}$ определялись яркости полос $\operatorname{XeCl}(D, B-X)$ и суммарная их яркость в данном диапазоне длин волн. За яркость полосы принималась площадь под соответствующей кривой на спектре излучения, который исправлялся с учетом относительной спектральной чувствительности монохроматора и фотоумножителя.

На рис. 4 представлены результаты оптимизации эксимерного излучателя с накачкой смеси Xe/Cl₂ ПТР от содержания молекул хлора и атомов ксенона. Вклад перехода XeCl(D-X) в УФ излучение плазмы ПТР не превышал 10–20%. Оптимальное содержание молекул Cl_2^* находилось в диапазоне 250–320 Ра. В области раз-



Рис. 5. Зависимость яркости излучения полосы с $\lambda = 236 \text{ nm XeCl}(D-X)$ от величины тока ПТР на смеси Xe/Cl₂ = 3.6/0.24 kPa.

рядных токов 1–20 mA зависимость яркости излучения полосы с $\lambda = 236$ nm от величины среднего тока I имеет линейную форму, а при более высоких токах наблюдается насыщение скорости роста яркости излучения (рис. 5). Такой вид зависимости $J = f(I_1)$ близок к зависимости интегральной мощности УФ излучения для продольного тлеющего разряда в широкой трубке [5], где при $I \ge 30$ mA наблюдался спад мощности УФ излучения с ростом тока. Максимальная средняя мощность излучения в области 180–340 nm составляла 3 W при КПД 8%.

Выводы

Исследование характеристик поднормального тлеющего разряда низкого давления на смеси Xe/Cl₂ в короткой разрядной трубке с малым внутренним диаметром показало, что он может служить достаточно эффективным источником стационарного излучения в области 180–340 nm (P = 3 W; КПД 8%); за счет сильного перекрытия молекулярных полос XeCl(D, B-X) и Cl₂(D-A) излучение имеет форму континуума с максимумами при $\lambda = 236, 258, 308$ nm; яркость излучения полосы 236 nm XeCl(D-X) не превышает 20% от сумммарной яркости УФ излучения лампы; оптимальное содержание молекул хлора находится в диапазоне 250–320 Pa, а давление ксенона равно 2 kPa.

Список литературы

- [1] Зайцев В.В., Зверевская Е.Ю., Зухер Я.И., Нетягов П.Д. // ТВТ. 1978. Т. 16. № 6. С. 1152–1157.
- [2] Зайцев В.В., Нетягов П.Д., Божко Н.В. // ТВТ. 1980. Т. 18. № 5. С. 944–948.
- [3] Данилин Б.С., Киреев В.Ю. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов. М.: Энергоатомиздат, 1987. 269 с.
- [4] Ефремов А.М., Куприяновская А.И., Светцов В.И. // Химия высоких энергий. 1993. Т. 27. № 1. С. 88–91.
- [5] Головицкий А.П. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. Вып. 8. С. 73–76.
- [6] Головицкий А.П., Кан С.Н. // Опт. и спектр. 1993. Т. 75. № 3. С. 604–609.
- [7] Головицкий А.П., Лебедев С.В. // Опт. и спектр. 1997. Т. 82. № 2. С. 251–255.
- [8] Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987.
 592 с.
- [9] Панченко А.Н., Тарасенко В.Ф. // Опт. и спектр. 1998. Т. 84. № 3. С. 389–392.
- [10] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И. и др. // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25. Вып. 11. С. 29–33.
- [11] Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И., Шевера И.В. Проблемы экономического и социального развития региона и практика научного эксперимента. Киев; Ужгород; Ниредьгаза: Карпаты, 2000. Вып. 16. С. 185–186.
- [12] Шуаибов А.К. // Письма в ЖТФ. 2000. Т. 26. Вып. 9. С. 1-6.
- [13] Шуаибов А.К., Дащенко А.И. // Квантовая электрон. 2000.
 Т. 30. № 3. С. 279–281.

- [14] Шуаибов А.К., Дащенко А.И. // ПТЭ. 2000. № 3. С. 101– 103.
- [15] Ломаев М.И., Панченко А.Н., Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф. // ЖТФ. 1998. Т. 68. Вып. 2. С. 64–68.